چکیدہ

در این پژوهش، نانوپوشش شفاف گرافن چندلایه جهت محافظت مس در برابر اکسیداسیون در دمای پائین مورد استفاده قرارگرفت و نقش این پوشش بر حفظ درخشندگی و جلوگیری از تغییر رنگ مس ارزیابی شد. برای این منظور، پوشش گرافن چندلایه با استفاده از فرایند رسوب شیمیایی بخار (CVD) بر زیرلایه مس اعمال شد. پوشش گرافن چندلایه قبل و بعد از آزمون اکسیداسیون با استفاده از آنالیز رامان، میکروسکوپهای نوری و الکترونی روبشی مشخصهیابی شد. علاوه بر این، تغییرات رنگ در فضای رنگ \*CIE-L\*a\*b و درصد بازتاب در محدوده طیف مرئی مطالعه شد. نتایج نشان داد که گرافن چندلایه شفاف ظاهر شفاف مس را پس از اکسیداسیون حرارتی تا ۴ ساعت در دمای <sup>C0</sup> در مان کند. نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که پوشش گرافن چندلایه در محافظت از اکسیداسیون و درنتیجه حفظ رنگ مس موثر است. علاوه بر این، نتایج این پژوهش نشان داد که اکسیداسیون و مرزهای دانه های گرافن گرافن قبیدلایه در محافظ می کند.

كلمات كليدى: مس، پوشش گرافن،اكسيداسيون، فضاى رنگى CIE Lab

## Evaluation of transparent multilayer graphene coating on copper for color and oxidation control at low temperatures

#### Abstract

In this research, transparent multi-layer graphene nanocoating was used to protect copper against oxidation at low temperature and the role of this coating on maintaining brightness and preventing copper color change was evaluated. For this purpose, multilayer graphene coatings were applied on copper substrate using chemical vapor deposition (CVD). The multilayer graphene coating before and after the oxidation test was characterized using Raman analysis, optical and scanning electron microscopes. In addition, the color changes in the CIE-L\*a\*b\* color space and the reflectance percentage in the range of the visible spectrum were studied. The results showed that the transparent multilayer graphene coating can maintain the appearance properties of copper after thermal oxidation for up to 4 hours. The results of the present research show that the multilayer graphene coating is effective in protecting the oxidation and as a result maintaining the color of copper. In addition, the results of this research showed that graphene oxidation starts and spreads from the defects and graphene grains boundaries.

Keywords: Copper; Graphene; Nanocoating; Oxidation; CIE Lab color space

Corresponding author. E-mail: h.asadipour@ma.iut.ac.ir (H. Asadipour).

یک شبکه لانه زنبوری شش ضلعی به هم متصل شدهاند. گرافن بهدلیل ترکیب خاصی از ساختار الکترونیکی، کریستالوگرافی و شیمیایی خود، دارای خواص خارق العاده ای مانند عبوردهی بالای نور، رسانایی حرارتی و الکتریکی بالا، دانسیته جریان الکتریکی بالا و مقاومت مکانیکی بالا است. گرافن دارای استحکام ذاتی بالایی است که آن را به قوی ترین ماده کشف شده با حداکثر مقاومت کششی ۵ GPA ۲۳۰ تبدیل می کند. نفوذ ناپذیری گرافن در برابر همه گازها و نمک ها، آن را به گزینه ای ایده آل برای پوشش های مقاوم به اکسیداسیون وخوردگی تبدیل می کند [۵]. علاوه بر این، یک لایه گرافن تقریباً ۹۸٪ شفافیت نوری دارد، در نتیجه می توان از آن به عنوان پوششی استفاده کرد که ظاهر فلزات را تغییر نمی دهد [۶].

گرافن را می توان با استفاده از لایهبرداری مکانیکی، رشد همبافته روی SiC ، احیای شیمیایی اکسیدگرافن، باز کردن نانو لولههای کربنی و رسوب شیمیایی بخار(CVD) تولید کرد[۷]. در میان روشهای ذکر شده، CVD معمولاً برای ساخت گرافن با تعداد لایههای تنظیمشده، سطح وسیع و کیفیت خوب استفاده می شود. علاوه بر این، با استفاده از فرآیندCVD، لایههای گرافن فوق العاده نازک می توانند

مستقیماً بر سطوح مسی با اشکال مختلف تولید شوند[۸]. با توجه به این تفاسیر بهنظر می رسد که گرافن می تواند گزینه مناسبی بهعنوان پوشش برای محافظت از مس در برابر اکسیداسیون بدون تغییر در خواص فیزیکی، ظاهری و رنگ مس باشد. هدف از این مطالعه بررسی و مقایسه عملکرد پوششهای گرافنی چندلایه روی مس در برابر اکسید اسیون حرارتی و همچنین تغییرات رنگ ناشی از اکسیداسیون بوده است. برای این منظور، ابتدا گرافن چندلایه توسط روش رسوب شیمیایی بخار (CVD) بر سطح مس سنتز شده است. بررسی پوششها قبل و بعد از آزمایشهای اکسیداسیون با روبشی انجام شد.

مرئی و مشخصه رنگسنجی در فضای رنگ CIELab اندازهگیری شد. نتایج این مطالعه در مقاله حاضر ارائه شده و ۱. مقدمه

مشکلی که کاربردهای مس را محدود میکند، تغییر خواص فيزيكي آن ناشي از اكسيداسيون فلز است. اين در حالي است که مس و آلیاژهای مبتنی بر مس نه تنها در انتقال برق و تجهيزات الكترونيكي بلكه در اشياء تزئيني و جواهرات و ساخت ارزها نیز کاربرد زیادی دارند. مس بهدلیل ظاهر جذابی که دارد، بهطور گسترده درساختمان و دکوراسیون خانه، معماری فضای باز مانند سقفها و روکش ها یا نماها استفاده می شود [1]. اکسیدهای تشکیل شده بر سطح مس قابلیت حفاظت فلز زمينه را نداشته و بالاتر از دماي اتاق پوسته خواهد شد. از طرف دیگر، اکسیداسیون سطحی مس منجر به تغییر رنگ آن میشود، درخشندگی و کیفیت سطح آن تحت تأثیر قرار می گیرد و کاربران زیادی را در بهکارگیری از مس در کاربردهای آن دچار تردید می کند [۲]. درنتیجه، پژوهش ها جهت دستیابی به راه حل های محافظت از مس در برابر اکسیدشدن دمای محیط و تغییر رنگ آن همواره مد نظر بوده است. باید در نظر داشت که هدف اصلی یوشش ها نه تنها محافظت از زیرلایه مسی در برابر اکسیداسیون ویا خوردگی است، بلکه می تواند نقش محافظت از درخشندگی سطح و رنگ فلز را نیز داشته باشد.

تاکنون پوششهای محافظ سنتی مانند لایههای اکسیدی و پوششهای فلزی به منظور محافظت از مس مطرح شدهاند که محدودیتهایی از جمله ماندگاری کوتاهمدت، ضخامت زیاد و زوال خواص فیزیکی فلز را بههمراه دارند و در بسیاری از موارد خواص مس را تغییر میدهند [۳]. این مشکلات ضرورت ارایه پوششی نازک و شفاف بر مس را بیش از پیش مطرح میکند.

فیلم گرافن یکی از پوششهایی است که بهدلیل خواص فوق العاده بالای آن توجه زیادی را به خود جذب کرده است [۴]. گرافن نازکترین ماده دو بعدی است که در حال حاضر استفاده میشود. گرافن، یکلایه از اتمهای کربن است که در بهمنظور بررسی تغییرات رنگ ناشی از اکسیداسیون، توزیع نور منعکس شده نمونهها به عنوان تابعی از طول موج در ناحیه

از نظر شرایط اکسیداسیون و تغییرات رنگ مورد بحث قرار گرفته است.

# ۲. مواد و روش ها

#### ۲–۱. لایه نشانی گرافن چند لایه روی مس

در این پژوهش از فویل مس با خلوص ۹۹/۹۹٪ به عنوان زيرلايه استفاده شد. ضخامت فويل مس مورد استفاده ۱ ميلي-متر بود. فویل های مسی به قطعه هایی با ابعاد ۲×۲ cm<sup>2</sup> بریده شدند. به منظور یوشش دهی در ابتدا فویل های مسی یولیش مکانیکی شدند و سپس در اتانول (Merck، آلمان) به مدت ۲۰ دقیقه چربیزدایی شدند و در نهایت شستشو با آب مقطر انجام گردید. به منظور پوششدهی از دستگاه رسوب شیمیایی بخار با قابلیت یوشش دهی در خلا استفاده شد. گازهای مورد استفاده جهت پوشش دهی گاز آرگون، هیدروژن و متان با خلوص ۹۹/۹۹۹٪ بودند. نمونه ها پس از برش، سمباده زنی و چربیزدایی برروی قایقکهای آلومینا و سیس داخل لوله از جنس كوارتز داخل دستگاه رسوب شيميايي بخار قرار داده شدند.در ابتدا فشار سیستم به ۳۴ میلیبار کاهش یافت. به محض ایجاد خلاء، هر دو گاز هیدروژن و آرگون به ترتیب با دبی ۴۵۰ SCCM و ۵۰۰ SCCM وارد محفظه شدند و همزمان دمای کوره بالا رفت. فشار حاصل ۹۸ میلیبار بود. سیس دمای کوره به ۱۰۰۰ درجه سانتی گراد افزایش یافته و در طول تشکیل یوشش ثابت نگه داشته شد. در این دما، هر گونه اکسید باقیمانده حذف می شود و همچنین تبلور مجدد و رشد دانههای مس صورت میگیرد. به منظور آنیل نمونهها ییش از باز کردن گاز متان، نمونهها به مدت ۱۵ دقیقه در دمای ۱۰۰۰ درجه سانتی گراد نگه داشته شدند. پس از این مرحله گاز متان با دبی ۳۶۰ SCCM و گاز هیدروژن با دبی ۴۸۰SCCM وارد محفظه شد تا تشکیل گرافن و پوشش-دهی آغاز شود. با افزودن گاز متان فشار محفظه به ۱۷۰ میلی بار افزایش یافت. پس از مرحله پوشش دهی که ۳۰ دقیقه به طول انجامید، همزمان با بستن گاز متان کوره خاموش شد و سیستم به آرامی تا دمای محیط خنک شد.

### ۲-۲. ارزیابی و مشخصهیابی

آزمایش های اکسیداسیون حرارتی در دمای ۲۰۰ درجه سانتی گراد در یک کوره معمولی Carbolite مدل RHF1400 برای زمان های مختلف انجام شد. در این پژوهش از آنالیز طیفسنجی رامان با مدل Ram مدل HRساخت شرکت Horiba ژاپن، با طول موج لیزری ۵۳۲ نانومتر استفاده شد. مورفولوژی گرافن، قبل و بعد از اکسیداسیون، به کمک میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) مدل XL30 ، مطالعه شد. به منظور بررسی تغییرات و مکانیزم اکسید اسیون از میکروسکوپ نوری NIKON مدل BPIPHOT300 استفاده شد.

## ۲–۳. آزمون رنگ سنجی

برای مشخص کردن رنگ مس پوشش داده شده با گرافن قبل و بعد از آزمایشهای اکسیداسیون، اندازه گیریهای رنگسنجی با استفاده از اسپکتروفتومتر مازتابی Spactroflash600 ساخت شرکت Datacolor درجه با منبع روشنایی D65 و مشاهده کننده استاندارد ۱۰ درجه انجام شد. رنگ در اینجا به دو صورت نشان داده شده است. فضای رنگ به کار رفته در این پژوهش، فضای رنگ فضای رنگ به کار رفته در این پژوهش، فضای رنگ Numra بینایی انسان دارد و به صورت گسترده ای برای اندازه سیستم بینایی انسان دارد و به صورت گسترده ای برای اندازه مورت سه بعدی است و دارای سه محور \*L ( محدوده روشنایی بین ۲۰ تا ۱۰۰)، \*a (محدوده رنگ های قرمز و سبز) و \*d (محدوده رنگ های آبی و زرد) می باشد.

در روش دوم، نمایش رنگ توسط منحنیهای طیف بازتاب در محدوده طیف بینایی انسان، یعنی طول موج بین ۴۰۰ تا ۷۰۰ نانومتر، نمایش داده میشود. اسپکتروفتومتر، طیف بازتابی اشیاء را اندازه گیری میکند.این دستگاه در هر طول موج، نور برخوردی به شیء را با نور ورودی آن مقایسه می-کند. اطلاعات عمدتاً با رنگ جسم مرتبط بوده و با منحنی-هایی که در آنها درصد بازتاب در مقابل طول موج و در فواصل منظم چهل نانومتری رسم شدهاند ارایه میگردند.

در ارزیابی مقادیر رنگ، مشخص کردن اینکه آیا تفاوت بین رنگها با چشم غیرمسلح قابل مشاهده است یا خیر، حائز اهمیت است. برای این ارزیابی، مقداراختلاف رنگ(ΔE) از تفاوت بین مقادیر اندازه گیری شده رنگ، محاسبه شد. فاصله دو رنگ (ΔE) به صورت زیرتعریف شده است.

$$\Delta E = (\Delta L^2 + \Delta a^2 + \Delta b^2)^{1/2}$$

وقتی مقدار اختلاف رنگ زیر عدد ۳ باشد، هیچ تغییر رنگ قابل توجهی با چشم غیرمسلح قابل مشاهده نیست. تفاوت واضح بین دو رنگ از مقدار ۳ قابل درک است. اگر مقادیر از پنج بیشتر شود، آنها دو رنگ متفاوت در نظر گرفته می شوند [۹]. در این تحقیق ΔE پس از مدت زمان های مختلف اکسیداسیون محاسبه شد و با رنگ مس قبل از اکسیداسیون، به منظور ارزیابی تغییرات رنگ مقایسه شد. هرنمونه با سه بار تکرار بررسی شد و اندازه گیری رنگ برای هر نمونه از متوسط ۵ موقعیت متفاوت گزارش شد.

> ۳. نتایج و بحث ۳-۱. ارزیابی یوشش گرافن چندلایه بر زیرلایه مس

روش طيفسنجي رامان بهعنوان يک تکنيک غيرمخرب استفاده می شود که قادر به تعیین تعداد لایه های گرافن و عيوب ساختار أن است [١٠]. شكل ١ أناليز رامان گرافن چند-لایه بهدست آمده از طریق رسوب شیمیایی بخار بر زیرلایه مس را نشان میدهد. D، G و D سه پیک متمایز گرافن هستند. طیف رامان (شکل۱) یک پیک G در <sup>1-</sup>۱۵۸۷ ،  ${
m cm}^{-1}$ یک  ${
m D}$  در  ${
m TV} \cdot {
m cm}^{-1}$  و یک پیک  ${
m D}$  را در ۱۳۴۵ نشان می دهد. وجود پیک D نشان می دهد که نقصهایی در ساختار گرافن وجود دارد[۱۱]. ضعیف بودن ییک D در این طیف رامان نشان می دهد که گرافن سنتز شده با عیوب کم می باشد. تعداد لایه های گرافن بر نسبت شدت ییک 2D به ییک G (  $I_{2D}/I_G$  ) تأثیر می گذارد. برای گرافن تک لایه، این نسبت بین ۲ تا ۳، برای گرافن دولایه بین مقدار ۱ تا ۲ و برای گرافن چندلایه این نسبت کمتر از یک است [1۲]. نسبت شدت I2D/IG در شکل ۱ برابر ۱/۷۲ است. یهنای ییک G و 2D بهترتیب ۴۱ cm<sup>-1</sup> و <sup>1</sup> ۶۴ cm که در گرافن چندلایه معمولا بالاتر از ۳۵ cm می باشد [١٣]. این نتایج تأیید می کند که گرافن سنتز شده چندلایه می باشد. در جدول ۱ مشخصات گرافن چندلایه یوشش داده شده بر مس بهطور خلاصه آورده شده است.



جدول۱. مشخصات پیکهای طیف رامان گرافن چندلایه پوشش داده شده بر مس

I <sub>D</sub> /I <sub>G</sub>	I <sub>2D</sub> /I <sub>G</sub>	FWHM <sub>2D</sub> (cm <sup>-1</sup> )	FWHM <sub>G</sub> (cm <sup>-1</sup> )	D (cm <sup>-1</sup> )	2D (cm <sup>-1</sup> )	G (cm <sup>-1</sup> )
•/١٢	• /٧٢	۶۴	41	1840	77.7	1044

ضریب انبساط حرارتی مثبت (۱۰/K<sup>- م</sup>۱۰/K) است [۱۴]، این تفاوت در ضریب انبساط حرارتی منجر به کرنش زیاد در فصل مشترک گرافن/ مس در طول فرآیند خنکسازی می شود [ ۱۶]. حین خنکسازی، زیرلایه مس تحت تنش کششی است که توسط انبساط حرارتی گرافن اعمال می شود و گرافن تحت تنش فشاری است که توسط انقباض حرارتی زیرلایه مس اعمال می شود. اجتناب از کرنش ناشی از عدم تطابق حرارتی در طول فرآیند خنکسازی غیرممکن است[۱۶]. تحت این شرایط با تشکیل دسته های پله ای مس، کرنش ناشی از عدم تطابق در ضریب انبساط حرارتی در فصل مشترک گرافن/مس آزاد می شود . شکل ۲ تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی از سطح گرافن چندلایه پوشیده شده بر سطح مس را در دو بزرگنمایی مختلف نشان می دهد. زیرلایه مس در طول فرآیند سنتز گرافن آنیل می شود، آنیل در دمای بالا منجر به رشد شدید دانه ها شده است ( شکل ۲(الف)). وجود دسته های پله ای مس در شکل ۲(ب) قابل مشاهده است. دمای حدود ۲۰۰۰ درجه سانتی گراد برای فعال شدن متان و شروع رشد گرافن بر زیرلایه مسی مورد نیاز است [۱۴]. به دلیل پیش ذوب سطحی، زمانی که مس به نقطه ذوب خود نزدیک می شود، برخی از بیرونی ترین اتم های سطح به حالت شبه مایع تبدیل می شوند. در این دما، گرافن بدون تنش است و کاملاً با زیرلایه مسی مطابقت دارد. از آنجایی که گرافن دارای ضریب انبساط حرارتی منفی (۲۰/K–۲۰×۸–) است [۱۵]، اما مس دارای



شکل۲. تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی از مس با پوشش گرافن چندلایه در دو بزرگنمایی.

۲-۳. نتایج رنگسنجی مس با پوشش گرافن

شکل ۳ (ج) نشان میدهد که با افزایش زمان اکسیداسیون، \*L بهطور پیوسته کاهش مییابد، علاوه بر این منحنیهای طیف بازتابی، که در شکل ۴ مشاهده میشود، نشان میدهد که با افزایش زمان اکسیداسیون، درصد بازتاب کاهش مییابد. رنگ و مشخصات رنگسنجی برای پوشش گرافن چندلایه بر مس در شکل۳ ارائه شده است. همان طور که در شکل۳ (الف و ب) مشاهده می شود، تا ۴ ساعت پس از اکسیداسیون، تغییر رنگ در نمونه ها قابل مشاهده نیست. همچنین مشخصه های رنگ سنجی ( شکل ۳ (ج)) نشان می دهد که تا ۴ ساعت پس از اکسیداسیون، نقاط \*a و \*d در اطراف نقطه اولیه قرار دارند. این بدان معناست که تا ۴ ساعت پس از گرافن قابل ملاحظه نیست.



شکل۳. مشخصههای رنگی نمونههای مس با پوشش گرافن چندلایه پس از اکسیداسیون در دمای ۲۰۰ درجه سانتیگراد در زمانهای مختلف: الف) تصویر گرفته شده با دوربین معمولی، ب) رنگ گزارش شده توسط دستگاه اسپکتروفتومتر و ج) مشخصههای رنگسنجی.



شکل۴. تغییرات طیف بازتابی فلز مس با پوشش گرافن چندلایه در اثر اکسیداسیون در دما ۲۰۰ درجه سانتیگراد در زمانهای مختلف.

طبق تحقیقات انجام شده، تغییرات رنگ در مس بدون پوشش حتی پس از ۱۵ دقیقه پس از اکسیداسیون بهراحتی با چشم قابل تشخیص است [۱۹]. بر اساس دادههای جدول ۲، مقادیر \*a و \*d برای مس با پوشش گرافن تغییرات قابل توجهی را تا ۴ ساعت پس از اکسیداسیون نداشتند. علاوه بر این \*L به طور پیوسته با افزایش زمان اکسیداسیون کاهش یافت. پس از ۴ ساعت اکسیداسیون، مقدار تغییرات رنگ( $\Delta$ E) در مس با پوشش گرافن مقداری برابر با ۲/۳۱ دارد که این تغییرات رنگ با چشم انسان قابل تشخیص نیست. پس از ۴ ساعت، مقدار $\Delta$ E به ۱۱/۵ رسید که با محدوده رنگ قابل تشخیص مطابقت دارد. مطالعه رفتار اکسیداسیون مس با پوشش گرافن برای توضیح این پدیدهها ضرورت دارد و در همان طور که در شکل ۴ مشاهده می شود، رفتار طیف بازتابی برای نمونه مس با پوشش گرافن چندلایه روند مشابهی با مس بدون پوشش نشان می دهد. مس در طول موجهای کوتاه تر (۴۰۰ نانومتر –۷۰۰ نانومتر) بازتاب بیشتری دارد در-بالاتر (۵۷۰ نانومتر –۷۰۰ نانومتر) بازتاب بیشتری دارد در-نتیجه یک رنگ قرمز-زرد خاص برای مس قابل مشاهده است.محدوده طیف مرئی که چشم انسان اغلب می تواند ببیند از ۴۰۰ نانومتر (بنفش) تا ۲۰۰ نانومتر (قرمز) است. اگر تمام اگر تمام نور در طیف مرئی منعکس شود، به نظر می رسد، اما رنگ آن سفید است. هنگامی که تنها بخشی از نور در طیف مرئی جذب شود، آن جسم رنگ مکمل خود را مطابق با به اصطلاح اختلاط کاهشی رنگ آشکار می کند. ظاهر براق مس و ظاهر قرمز اکسید مس (Cu<sub>2</sub>O) همه از پیامدهای اختلاط

$\Delta \mathbf{E}$	b*	a*	L*	زمان اكسيد اسيون
				(ساعت)
_	$1 / \Delta  \pm  / \cdot 7$	19/44 ±•/•4	۸۲/•۳ ±•/•۳	•
•/۴	۱۸/۶۶ ±۰/۰۳	۱۶/V۹ ±•/•۸	۸۱/۸۴ ±۰/۰۴	١
1/10	۱۹/•۴ ±•/•V	<b>ヽヽ/ヽキ キ・/・</b> ۲	۸۱/۳۴ ±۰/۰۲	٢
۲/۳۱	۲•/•۶ ±•/•۵	$1\sqrt{20} \pm 1/16$	۸•/ ۶۵ ±•/•۶	۴
۵/۱۱	22/00 ± • / • 2	<b>ヽ</b> ∧/∨ヽ ±・/٣ヽ	$V^{V}$	۶
11/1	78/41 ±•/7V	$1 \sqrt{2} \times \sqrt{2}$	V\$/77 ±•/78	٨
18/•8	۲۶/•۳±•/۷۶	$1\sqrt{49} \pm 1/1$	$\gamma V/\Lambda\Lambda \pm 1/1V$	١٢
19/01	20/94 ± • /14	17/17 エ・/・۴	$9$ %/• $\Lambda \pm $ •/•V	١٨
۲۸/۵	14/V8 ±•/44	۱۲/۳۴ ±•/۳۸	$\delta $ /· $\Lambda \pm 1/\Lambda $ ۹	74
377/30	9/94 ±•/91	۸/۲۲ ±۰/۷۸	$\Delta \cdot / \Lambda A \pm \cdot / P F$	۴۸

جدول۲. پارامترهای رنگسنجی و تغییرات رنگ (ΔE) برای مس با پوشش گرافن چندلایه پس از دورههای مختلف اکسیداسیون

#### ٣-٣. گرافن چندلايه بهعنوان لايه محافظ

شکل ۵ تصاویر میکروسکوپی نوری از سطح مس با پوشش گرافن را پس از آزمایش های اکسیداسیون در دمای ۲۰۰ درجه سانتی گراد برای مدت زمان های مختلف نشان می دهد. در شکل۵ (الف) که ظاهر نمونه قبل از اکسیداسیون را نشان می-دهد، یک مرزدانه از زیرلایه مشهود است. به طورکلی، مرز-دانه های گرافن با استفاده از میکروسکوپ نوری به دلیل نانو مقیاس بودن مرزها، پیش از اکسیداسیون، قابل مشاهده نمی باشند [۲۰].

از آنجایی که گرافن از نظر حرارتی و شیمیایی در دماهای پایین پایدار است و همچنین در برابر تمام مولکولها و اتمهای هوا مقاوم است، در شرایط ایدهآل، سطح زیرلایه توسط گرافن، از اکسیداسیون محافظت می شود. گرافن در مقیاس بزرگ که توسط فرایند رسوب شیمیایی بخار تشکیل می شود، شامل عیوب ذاتی مانند جاهای خالی و عیوب خطی

است. میزان عیوب ساختاری گرافن به پارامترهای رشد و شرایط سنتز گرافن به روش CVD بستگی دارد [۲۱].

همان طور که در تصاویر مشهود است اکسید اسیون گرافن از مرزدانههای گرافن آغاز می شود و با افزایش زمان اکسیداسیون مرزدانهها ضخیم تر می شوند تا جایی که کل پوشش تخریب می شود. نقص هایی مانند مرز دانه ها و عیوب نقطه ای می توانند به عنوان کانالی برای انتشار اکسیژن عمل کنند و منجر به تغییرات رنگ ناشی از اکسیداسیون در سطح مس شوند که به وضوح در تصاویر میکروسکوپی نوری قابل مشاهده است. مرزدانه در گرافن مشخصاً از طریق پیوستن جزایر گرافنی مجاور شکل می گیرد[۲۲]. دانه های گرافن با جهت گیری می شوند که منجر به تشکیل گرافن پلی کریستالی رشد یافته با مرزهای نامتناسب بین دانه های گرافن مجاور می شود. فرزهای دانه، عیوب خطی هستند که از حلقه های کربنی پنج ضلعی، هفت ضلعی، هشت ضلعی و همچنین عیوب استون-

ولز تشکیل شدهاند [۲۳]. مرزهای دانه زمانی که دانههای گرافن به طور بیعیب و نقصی به هم متصل شوند به وجود نمی آیند، بلکه مرزدانه ها در تقاطع دو دانه با جهت گیری های متفاوت تشکیل می شود. درنتیجه، اگر پس از اکسیداسیون هیچ خط اکسیداسیونی وجود نداشته باشد، نشانگر آن است که هیچ مرزدانه ای در محل اتصال نواحی وجود ندارد و همچنین دو ناحیه گرافن مجاور جهت گیری یکسانی دارند. علاوه بر این، اگر خط اکسیداسیون در محل اتصال پس از اکسیداسیون قابل مشاهده باشد، دو دانه جهت گیری متفاوتی دارند و یک مرزدانه بین آن ها است.

با توجه به تصاویر میکروسکوپی نوری (شکل۵)، توزیع عیوب نقطهای را میتوان از طریق اکسیداسیون مس پوشش داده شده با گرافن مشاهده کرد. بهطور کلی میتوان گفت که اندازه عیوب نقطهای در مقیاس نانومتری است، اما از آنجایی که پایداری گرافن در اطراف این عیوب ضعیف است، بنابراین، این عیوب میتوانند بهعنوان مسیری برای انتشار اکسیژن عمل کنند و باعث اکسیداسیون مس شده و منجر به گسترش آن شود.



شکل ۵. تصاویر میکروسکوپی نوری از سطح مس با پوشش گرافن چندلایه پس از آزمایشهای اکسیداسیون در دمای ۲۰۰ درجه سانتی گراد برای مدت زمانهای مختلف: الف) پیش از اکسیداسیون، ب) پس از ۲ ساعت، ج) ۴ ساعت، د) ۶ ساعت، ه) ۸ ساعت، ی) ۱۲ ساعت، و)۱۸ ساعت، ن) ۲۴ ساعت و م)۸۸ ساعت.

شکل ۶ طیف رامان گرافن چندلایه در داخل دانه ها را پس از ۲ و ۴ ساعت اکسیداسیون نشان میدهد. اثری از پیکهای

اکسید مس در طیف رامان بهدست آمده، پس از ۲ و ۴ ساعت اکسیداسیون در داخل دانه گرافن قابل مشاهده نیست. تغییر به مقادیر ۲۹۹، و ۲/۶۶ کاهش یافت. پس از دو ساعت اکسید اسیون در پیکها جابجایی دیده نمی شود ولی پس از ۴ ساعت اکسید اسیون پیک 2D به مقدار <sup>1-</sup> ۲ جابجا شده است. این تغییرات در نسبت شدت پیکها و همچنین جابجایی در پیک 2D، ناشی از آسیب در پوشش گرافن چندلایه ناشی از اکسیداسیون در دمای ۲۰۰ درجه سانتی گراد است [۲۵]. موقعیت پیکها بههمراه افزیش در پیک D نشاندهنده زمینههای آسیب در پوشش گرافن است [۲۴]. قبل از اکسید-اسیون شدت پیک D به G، ۱/۱۰ بود که پس از ۲ و ۴ ساعت اکسید اسیون به مقدار ۱۸/۰ و ۲۳/۰ رسید. افزایش در این نسبت نشاندهنده گسترش عیوب است [۲۴]. علاوه بر این نسبت شدت پیک2D به پیک G برابر با ۷۲/۰ بود که بهترتیب



شکل ۶. طیف رامان فلز مس با پوشش گرافن چندلایه پس از اکسیداسیون: الف) پس از ۲ ساعت و ب) پس از ۴ ساعت.

۴. نتیجهگیری

دست آمده از آنالیز رامان و تصاویر میکروسکوپ نوری از پوشش گرافن پس از اکسیداسیون نشان میدهد که پوشش گرافن به طور موثری از مس در برابر اکسیداسیون محافظت می کند. گسترش اکسیداسیون در مس از طریق عیوب و مرز دانههای گرافن اتفاق می افتد؛ با افزایش زمان اکسیداسیون، ضخامت مرزدانهها افزایش مییابد و سطح مس به رنگ های تیرهتر تغییر می کند. در این پژوهش، عملکرد نانوپوشش شفاف گرافن چندلایه، تهیه شده به روش رسوب شیمیایی بخار، به منظور محافظت از مس در برابر اکسیداسیون حرارتی و همچنین نقش این پوشش بر حفظ رنگ و درخشندگی مس ارزیابی شد. تصاویر میکروسکوپی الکترونی روبشی نشان داد که بر سطح مس با پوشش گرافن دستههای پلهای تقریباً موازی پدید میآید که ناشی از تفاوت در ضریب انبساط حرارتی بین مس و گرافن، در مرحله خنکسازی، در فرایند پوشش دهی است. طیف بازتابی برای مس پوشش داده شده با نانوپوشش چندلایه روند مشابهی را با مس بدون پوشش نشان می دهد. این نتیجه حاکی از آن است که گرافن شفاف چندلایه می تواند رنگ مس را پیش از قرارگیری در معرض اکسیداسیون حفظ کند. نتایج به

#### References

- [1] Beyond Provenance: New Approaches to Interpreting the Chemistry of Archaeological Copper Alloys, 2018.
- [2] M.R. Bateni, S. Mirdamadi, F. Ashrafizadeh, J.A. Szpunar, R.A.L. Drew, Oxidation behaviour of titanium coated copper substrate, Surf. Coatings Technol. 139 (2001) 192–199.
- [3] S.H. Cho, S.R. White, P. V. Braun, Selfhealing polymer coatings, Adv. Mater. 21 (2009) 645–649.
- [4] A.A. Iqbal, N. Sakib, A.K.M.P. Iqbal, D.M. Nuruzzaman, Graphene-based nanocomposites and their fabrication, mechanical properties and applications, Materialia. 12 (2020). https://doi.org/10.1016/j.mtla.2020.100815.
- [5] S. Böhm, Graphene against corrosion, Nat. Nanotechnol. 9 (2014) 741–742.
- [6] C. Mattevi, H. Kim, M. Chhowalla, A review of chemical vapour deposition of graphene on copper, J. Mater. Chem. 21 (2011) 3324– 3334.
- [7] Chaitoglou, S., Bertran, E., Andujar, J.L., Growth Study and Characterization of Single-Layer Graphene Structures Deposited on Copper Substrate by Chemical Vapour Deposition, 2016.
- [8] Li, X., Cai, W., An, J., Kim, S., Nah, J., Yang, D., Piner, R., Velamakanni, A., et al., "Largearea synthesis of high-quality and uniform graphene films on copper foils", *Science*, Vol. 324, No. 5932, pp. 1312–1314, 2009.
- [9] Mokrzycki, W., Tatol, M., Color difference Delta E - A survey Colour difference  $\Delta E$  - A survey Faculty of Mathematics and Informatics, 2011.
- [10] Ferrari, A.C., Meyer, J.C., Scardaci, V., Casiraghi, C., Lazzeri, M., Mauri, F., Piscanec, S., Jiang, D., et al., "Raman spectrum of graphene and graphene layers", *Physical Review Letters*, Vol. 97, No. 18, 2006.
- [11] Hodkiewicz J., Application Note: 51946 Characterizing Graphene with Raman Spectroscopy, 2010.

- [12] Nguyen, V.T., Le, H.D., Nguyen, V.C., Ngo, T.T.T., Le, D.Q., Nguyen, X.N., Phan, N.M., "Synthesis of multi-layer graphene films on copper tape by atmospheric pressure chemical vapor deposition method", *Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology*, Vol. 4, No. 3, 2013.
- [13] Sharma, I., Papanai, G.S., Paul, S.J., Gupta, B.K., "Partial Pressure Assisted Growth of Single-Layer Graphene Grown by Low-Pressure Chemical Vapor Deposition: Implications for High-Performance Graphene FET Devices", *ACS Omega*, Vol. 5, No. 35, pp. 22109– 22118, 2020.
- [14] Deng, B., Wu, J., Zhang, S., Qi, Y., Zheng, L., Yang, H., Tang, J., Tong, L., et al., "Anisotropic Strain Relaxation of Graphene by Corrugation on Copper Crystal Surfaces", *Small*, Vol. 14, No. 22, 2018.
- [15] Yoon, D., Son, Y.W., Cheong, H., "Negative thermal expansion coefficient of graphene measured by raman spectroscopy", *Nano Letters*, Vol. 11, No. 8, pp. 3227–3231, 2011.
- [16] Kang, J.H., Moon, J., Kim, D.J., Kim, Y., Jo, I., Jeon, C., Lee, J., Hong, B.H.,
  "Strain Relaxation of Graphene Layers by Cu Surface Roughening", *Nano Letters*, Vol. 16, No. 10, pp. 5993–5998, 2016.
- [17] Bide, M., Color for science, art and technology, edited by Kurt Nassau, 1998.
- [18] Seybold, G., "Book Review: Colour Chemistry. By R. M. Christie", Angewandte Chemie International Edition, Vol. 41, No. 2, pp. 366, 2002.
- [19] H. Asadipour, M. Alizadeh, F. Ashrafizadeh, Evaluation of graphene transparent coating on copper for color

and oxidation control at low temperatures, Diam. Relat. Mater. (2022).

- [20] Duong, D.L., Han, G.H., Lee, S.M., Gunes, F., Kim, E.S., Kim, S.T., Kim, H., Ta, Q.H., et al., "Probing graphene grain boundaries with optical microscopy", *Nature*, Vol. 490, No. 7419, pp. 235–239, 2012.
- [21] Kwak, J., Jo, Y., Park, S.D., Kim, N.Y., Kim, S.Y., Shin, H.J., Lee, Z., Kim, S.Y., et al., "Oxidation behavior of graphenecoated copper at intrinsic graphene defects of different origins", *Nature Communications*, Vol. 8, No. 1, 2017.
- [22] Yu, Q., Jauregui, L.A., Wu, W., Colby, R., Tian, J., Su, Z., Cao, H., Liu, Z., et al., "Control and characterization of individual grains and grain boundaries in graphene grown by chemical vapour deposition", *Nature Materials*, Vol. 10, No. 6, pp. 443–449, 2011.
- [23] Li, X., Cai, W., An, J., Kim, S., Nah, J., Yang, D., Piner, R., Velamakanni, A., et al., "Large-area synthesis of high-quality and uniform graphene films on copper foils", *Science*, Vol. 324, No. 5932, pp. 1312–1314, 2009.
- [24] Gertsman, V.Y., Hoffmann, M., Gleiter, H., Birringer, R., "The study of grain size dependence of yield stress of copper for a wide grain size range", *Acta Metallurgica Et Materialia*, Vol. 42, No. 10, 1994.
- [25] Luo, B., Whelan, P.R., Shivayogimath, A., Mackenzie, D.M.A., Bøggild, P., Booth, T.J., "Copper Oxidation through Nucleation Sites of Chemical Vapor Deposited Graphene", *Chemistry of Materials*, Vol. 28, No. 11, pp. 3789– 3795, 2016.